

a 2016 0050

Invenția se referă la domeniul nanomaterialelor polimerice și a structurilor fotosensibile pe baza lor, care pot fi utilizate în optoelectronică pentru realizarea dispozitivelor fotovoltaice și a purtătorilor de informație electrofotografică.

Stratul fotosensibil pe baza de copolimer carbazolic conține copolimer de N-vinilcarbazol cu 1-octenă sensibilizat cu 15% mas. de 2,4,7-trinitrofluorenonă și 10...50% mas. de ftalocianină de cupru, grosimea stratului fotosensibil fiind de 1...10 μm .

Revendicări: 1

Figuri: 2